PRODUCTION OF SILICON-CONTAINING RESIN

Patent number:

JP6172473

Publication date:

1994-06-21

Inventor:

MATSUMURA KOUZABUROU; WATANABE KENICHI;

KAKIUCHI HIDEAKI

Applicant:

CHISSO CORP

Classification:

- international:

C08F299/08; C08F212/08; C08F220/18; C08F230/08;

C09D143/04

- european:

Application number: JP19920351342 19921207 Priority number(s): JP19920351342 19921207

Report a data error here

Abstract of JP6172473

PURPOSE:To provide a process for producing a silicon-containing resin having excellent long-term stain resistance and storage stability without deteriorating the strong points of silicon-containing resin. CONSTITUTION:A silicon-containing resin is produced by radically polymerizing (a) at least one kind of monomer selected from acrylic acid esters, methacrylic acid esters and styrenes, subsequently charging the polymerization system with a mixture composed of (b) at least one kind of polysiloxane macromonomer containing vinyl group, (c) a mixture of at least one kind of silane compound containing vinyl group and optionally further (d) at least one kind of polymerizable monomer having carboxylic acid group and carrying out the radical copolymerization in two steps.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-172473

(43)公開日 平成6年(1994)6月21日

F I 技術表示的	服番号	庁内	識別記号	5	(51) Int.Cl. ⁵	
	J	7442	MRY	299/08	C08F	
	J	7211	мјх	212/08		
	J	7242	MLY	220/18		
	J	7242	MNU	230/08		
	J	7921	PGL	143/04	C 0 9 D	
審査請求 未請求 請求項の数3(全 12)						
(71)出願人 000002071			顧平4-351342	肾号	(21)出願番	
チッソ株式会社						
大阪府大阪市北区中之島 3 丁目 6 番32号		月7日	成4年(1992)12	∃	(22)出願日	
(72)発明者 松村 功三郎						
神奈川県横浜市金沢区乙舳町10番1号						
(72)発明者 渡辺 健一						
神奈川県横浜市金沢区乙舳町10番2号						
(72)発明者 垣内 秀明						
埼玉県北葛飾郡庄和町米島358番地49						
(74)代理人 弁理士 野中 克彦						

(54) 【発明の名称】 ケイ素含有樹脂の製造方法

(57)【要約】

[目的] ケイ素含有樹脂の長所を損なうことなく、長期にわたる耐汚染性および保存安定性に優れたケイ素含有樹脂の製造法を提供する。

【構成】 (a) アクリル酸エステル類、メタクリル酸エステル類、及びスチレン類から選ばれる少なくとも1種のモノマーをラジカル重合した後に、引き続き(b)少なくとも1種のビニル基含有ポリシロキサンマクロモノマー、(c)少なくとも1種のビニル基含有シラン化合物モノマーの混合物、もしくはさらに(d)少なくとも1種のカルボン酸基を有する重合性モノマーを加えた混合物を重合系に添加し、2段階でラジカル共重合することによりケイ素含有樹脂を製造する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (a) アクリル酸エステル類、メタクリ ル酸エステル類、及びスチレン類から選ばれる少なくと も1種のモノマー、(b)少なくとも1種のビニル基含 有ポリシロキサンマクロモノマー、及び(c)少なくと も1種のビニル基含有シラン化合物モノマーの共重合に よりケイ素含有樹脂を製造する方法において、モノマー 成分(a)をラジカル重合した後に、引き続きモノマー 成分(b)及びモノマー成分(c)の混合物を重合系に 添加し2段階でラジカル共重合を行うことを特徴とする 10 ピニル基含有シラン化合物モノマーの混合物もしくはさ ケイ素含有樹脂の製造方法。

【請求項2】 (a) アクリル酸エステル類、メタクリ ル酸エステル類、及びスチレン類から選ばれる少なくと も1種のモノマー、(b)少なくとも1種のビニル基含 有ポリシロキサンマクロモノマー、(c)少なくとも1 種のビニル基含有シラン化合物モノマー、及び(d)少 なくとも1種のカルボン酸基を有する重合性モノマーの 共重合によりケイ素含有樹脂を製造する方法において、 モノマー成分 (a) をラジカル重合した後に、引き続き 一成分(d)の混合物を重合系に添加し2段階でラジカ ル共重合を行うことを特徴とするケイ素含有樹脂の製造

【請求項3】 ラジカル共重合反応により得られる共重 合体の重量平均分子量が、5000万至30000で あることを特徴とする請求項1もしくは請求項2のいず れか1項記載のケイ素含有樹脂の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

法に関する。特に長期耐汚染性および保存安定性に優れ たケイ素含有樹脂の製造方法を提供するものであり、こ のケイ素含有樹脂は塗料用のベース樹脂として有用であ る。

[00002]

【従来の技術】従来、ポリシロキサンマクロモノマー及 びシラン化合物モノマーを(メタ)アクリルモノマーと 共重合せしめることにより、耐汚染性並びに無機材料の 塗剤としたときの無機材料に対する密着性に優れたケイ 素含有樹脂が製造できることは知られている。(特開昭 40 61-78806号公報)。しかしながら、該ケイ素含 有樹脂は屋外において暴露された場合、ある程度の期間 であれば被塗装物の美観を維持することが可能である が、長期に渡ってその美観を維持することは難しく、耐 汚染性の長期持続性の面で劣っていた。また樹脂骨格中 に加水分解可能なシリル基を有するため、保存中に、系 内に存在する水分および系外から混入する水分と反応す ることにより粘度が上昇し、塗装が困難になるなどの問 題があった。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明者等は該ケイ素 含有樹脂の有する長所、すなわち耐汚染性および無機材 料に対する密着性を損なうことなく、長期に渡る耐汚染 性の維持および保存安定性に優れたケイ素含有樹脂を得 るべく鋭意研究した。その結果、(a)アクリル酸エス テル類、メタクリル酸エステル類、及びスチレン類から 選ばれる少なくとも1種のモノマーをラジカル重合した 後に、引き続き(b)少なくとも1種のピニル基含有ポ リシロキサンマクロモノマー、(c) 少なくとも1種の らに(d)少なくとも1種のカルボン酸基を有する重合 性モノマーを加えた混合物を重合系に添加し2段階でラ

2

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明は下記(1)~ (3) で示す構成を有する。

ジカル共重合をすることにより得られるケイ素含有樹脂

が上記課題を解決することを見いだし本発明を完成し

- (a) アクリル酸エステル類、メタクリル酸エ モノマー成分(b)、モノマー成分(c)、及びモノマ 20 ステル類、及びスチレン類から選ばれる少なくとも1種 のモノマー、(b) 少なくとも1種のビニル基含有ポリ シロキサンマクロモノマー、及び(c)少なくとも1種 のピニル基含有シラン化合物モノマーの共重合によりケ イ素含有樹脂を製造する方法において、モノマー成分 (a) をラジカル重合した後に、引き続きモノマー成分 (b) 及びモノマー成分(c) の混合物を重合系に添加 し2段階でラジカル共重合を行うことを特徴とするケイ 素含有樹脂の製造方法。
- (a) アクリル酸エステル類、メタクリル酸エ (2) 【産業上の利用分野】本発明はケイ素含有樹脂の製造方 30 ステル類、及びスチレン類から選ばれる少なくとも1種 のモノマー、(b) 少なくとも1種のビニル基含有ポリ シロキサンマクロモノマー、(c) 少なくとも1種のピ ニル基含有シラン化合物モノマー、及び(d)少なくと も1種のカルボン酸基を有する重合性モノマーの共重合 によりケイ素含有樹脂を製造する方法において、モノマ 一成分(a)をラジカル重合した後に、引き続きモノマ 一成分(b)、モノマー成分(c)、及びモノマー成分 (d) の混合物を重合系に添加し2段階でラジカル共重 合を行うことを特徴とするケイ素含有樹脂の製造方法。
 - (3) ラジカル共重合反応により得られる共重合体の 重量平均分子量が、5000~30000であること を特徴とする前記第(1)項もしくは第(2)項記載の ケイ素含有樹脂の製造方法。

これらの構成により、長期に渡る耐汚染性の維持及び保 存安定性に優れたケイ素含有樹脂を製造することができ る。なお、重量平均分子量はゲルパーミエイションクロ マトグラフィー(GPC法)により測定したもので、ポ リスチレン換算である。

【0004】つぎに本発明を詳しく説明する。本発明の 50 特徴は、次に具体例を挙げるモノマー成分(a)~

(c) もしくはモノマー成分 (a) ~ (d) の共重合に 際して、2段階にラジカル重合せしめることによりケイ 素含有樹脂を製造することにある。モノマー成分(a) としては、アクリル酸エステル類、メタクリル酸エステ ル類及びスチレン類から選ばれる少なくとも1種のモノ マーを全単量体の50~95重量%使用する。使用割合 がその範囲外ではケイ素含有樹脂の物性が不良となるお それがある。また、成分(a)としてスチレン類だけだ と耐候性が多少劣るのでアクリル酸エステル類およびメ タクリル酸エステル類から選ばれる少なくとも1種のモ 10 ノマーを同時に使用したほうが樹脂として好ましい結果 が得られる。アクリル酸エステル類およびメタクリル酸 エステル類は、エポキシ基および/または水酸基を含有 しているものも好適に使用できる。成分(a)の具体例 としてはアクリル酸エチル、アクリル酸 n - ブチル、ア クリル酸2-ヒドロキシエチル、アクリル酸2-エチル ヘキシルのようなアクリル酸エステル類、メタクリル酸 メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸n-プチ ル、メタクリル酸シクロヘキシル、メタクリル酸グリシ ジル、メタクリル酸2-ヒドロキシエチル、メタクリル 20 酸ジメチルアミノエチル、メタクリル酸ラウリル、メタ クリル酸ステアリルのようなメタクリル酸エステル類、 およびスチレン、α-メチルスチレン、クロロメチルス チレンのようなスチレン類が挙げられる。

【0005】モノマー成分(b)としては、ピニル基を 含有したポリシロキサンマクロモノマーの少なくとも1 種を全単量体の0.01~20重量%使用する。使用割 合が 0.01%未満では耐汚染性が不良となるおそれが あり、20%を越えると本発明のケイ素含有樹脂の上に 更に塗膜を形成させる場合、樹脂間における接着性(塗 30 膜補修性)が不良になるおそれがある。モノマー成分 (b) としては、重量平均分子量が100~10000 0の化合物が好ましく、下記に示す。 (式中nは正の整 数である。)

[0006] (化1)

$$CH_{2}=CH \xrightarrow{\begin{pmatrix} CH_{3} \\ | \\ Si-O \\ | \\ CH_{3} \end{pmatrix}} \xrightarrow{CH_{3}} CH_{3}$$

[0007] [化2]

$$CH_{2}=CH \xrightarrow{\begin{array}{c} CH_{3} \\ | \\ Si-O \\ | \\ CH_{3} \end{array}} \xrightarrow{\begin{array}{c} CH_{3} \\ | \\ Si-OCH_{3} \\ | \\ OCH_{3} \end{array}$$

$$CH_2 = CH + \begin{pmatrix} CH_3 \\ 1 \\ Si - O \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} CH_3 \\ 1 \\ CH_3 \end{pmatrix} = CH_3$$

$$CH_3 + CH_3$$

[0008] 【化3】

 $CH_{2} = CH \xrightarrow{\begin{pmatrix} CH_{3} \\ | \\ Si-O \\ | \\ CH_{3} \end{pmatrix}} \xrightarrow{OC_{2}H_{5}}$ $CC_{2}H_{5}$ $CH_{2} = CH \xrightarrow{CH_{3}} OC_{2}H_{5}$

$$CH_{2} = CH + \begin{pmatrix} CH_{3} \\ | \\ Si - O \\ | \\ CH_{3} \end{pmatrix} + CH_{3} \\ | Si - OC_{2}H_{5}$$

[0009]

【化4】

-753-

 $CH_{2}=CH \xrightarrow{CH_{3}} CH_{3} OCH_{3}$ $CH_{2}=CH \xrightarrow{Si-O} Si-(CH_{2})_{2}-Si-OCH_{3}$ $CH_{3} CH_{3} OCH_{3}$

$$CH_{2} = CH \xrightarrow{\begin{pmatrix} CH_{3} \\ | \\ | \\ Si - O \\ | \\ | \\ CH_{3} \end{pmatrix}_{n} \xrightarrow{CH_{3}} \xrightarrow{OC_{2}H_{5}} \xrightarrow{OC_{2}H_{5}}$$

[0010]

$$\begin{array}{c} H \\ C H_{2} = C - C - O - (C H_{2})_{3} \\ | \\ C H_{3} \\ | \\ C H_{$$

$$\begin{array}{c} H \\ C H_2 = C - C - O - (C H_2) & 3 & C H_3 \\ | & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | & | \\ C H_3 & | & | \\ C$$

[0011]

$$\begin{array}{c} H \\ | \\ C H_2 = C - C - O - (C H_2) & 3 & \begin{pmatrix} C H_3 \\ | \\ S i - O \\ | \\ C H_3 \end{pmatrix} & C H_3 \\ | \\ C H_3 & C H_3 \\ | \\ C H_3 & C H_3 \\ \end{array}$$

[0012]

$$\begin{array}{c} H \\ | \\ CH_{2} = C - C - O - (CH_{2}) \\ | \\ O \end{array} \qquad \begin{array}{c} CH_{3} \\ | \\ Si - O \\ | \\ CH_{3} \end{array} \begin{array}{c} CH_{3} \\ | \\ Si - OC_{2}H_{5} \\ | \\ CH_{3} \end{array}$$

[0013] * * [化8]

$$CH_2 = C - C - O - (CH_2)$$
 3 CH_3 OCH3 | CH3 OCH3 | CH3 OCH3 | CH3 OCH3 | CH3 OCH3

$$\begin{array}{c} H \\ | \\ CH_2 = C - C - O - (CH_2)_3 \\ | \\ | \\ CH_3 \\ | \\ CH$$

$$\begin{array}{c} CH_3 \\ | \\ CH_2 = C - C - O - (CH_2)_3 \end{array} + \begin{array}{c} CH_3 \\ | \\ Si - O \\ | \\ CH_3 \end{array} \begin{array}{c} OCH_3 \\ | \\ Si - OCH_3 \\ | \\ CH_3 \end{array}$$

$$[0015]$$

-755-

$$\begin{array}{c} C \text{ H s} \\ | \\ C \text{ H 2} = C - C - O - (C \text{ H 2}) \text{ 3} & \begin{pmatrix} C \text{ H 3} \\ | \\ S \text{ i} - O \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} C \text{ H 3} \\ | \\ S \text{ i} - O \text{ C H 3} \\ | \\ C \text{ H 3} \end{pmatrix} & C \text{ H 3} \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{c} C H_3 \\ | \\ C H_2 = C - C - O - (C H_2)_3 \\ | \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} C H_3 \\ | \\ S i - O \\ | \\ C H_3 \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} C H_3 \\ | \\ S i - O C_2 H_5 \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{c} C \, H_{\,3} \\ C \, H_{\,2} = C \, -C \, -O \, -\, (C \, H_{\,2}) \, \, _3 \, & \begin{array}{c} C \, H_{\,3} \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} & \begin{array}{c} C \, H_{\,3} \\ \\ \\ S \, i \, -O \\ \\ \\ \end{array} & \begin{array}{c} C \, H_{\,3} \\ \\ \\ \\ S \, i \, -\, (C \, H_{\,2}) \, \, _2 \, -\, S \, i \, -\, O \, C_{\,2} \, H_{\,5} \\ \\ \\ \\ \\ C \, H_{\,3} \\ \end{array} & \begin{array}{c} C \, H_{\,3} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} & \begin{array}{c} C \, H_{\,3} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} & \begin{array}{c} C \, H_{\,3} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} & \begin{array}{c} C \, H_{\,3} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} & \begin{array}{c} C \, H_{\,3} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} & \begin{array}{c} C \, H_{\,3} \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} & \begin{array}{c} C \, H_{\,3} \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} & \begin{array}{c} C \, H_{\,3} \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} & \begin{array}{c} C \, H_{\,3} \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} & \begin{array}{c} C \, H_{\,3} \\ \\ \\ \\ \end{array} & \begin{array}{c} C \, H_{\,3} \\ \\ \\ \\ \end{array} & \begin{array}{c} C \, H_{\,3} \\ \\ \\ \\ \end{array} & \begin{array}{c} C \, H_{\,3} \\ \\ \\ \\ \end{array} & \begin{array}{c} C \, H_{\,3} \\ \\ \\ \\ \end{array} & \begin{array}{c} C \, H_{\,3} \\ \\ \\ \end{array} & \begin{array}{c} C \, H_{\,3} \\ \\ \\ \end{array} & \begin{array}{c} C \, H_{\,3} \\ \\ \\ \end{array} & \begin{array}{c} C \, H_{\,3} \\ \\ \\ \end{array} & \begin{array}{c} C \, H_{\,3} \\ \\ \\ \end{array} & \begin{array}{c} C \, H_{\,3} \\ \\ \\ \end{array} & \begin{array}{c} C \, H_{\,3} \\ \\ \\ \end{array} & \begin{array}{c} C \, H_{\,3} \\ \\ \\ \end{array} & \begin{array}{c} C \, H_{\,3} \\ \\ \\ \end{array} & \begin{array}{c} C \, H_{\,3} \\ \\ \\ \end{array} & \begin{array}{c} C \, H_{\,3} \\ \\ \\ \end{array} & \begin{array}{c} C \, H_{\,3} \\ \\ \\ \end{array} & \begin{array}{c} C \, H_{\,3} \\ \\ \\ \end{array} & \begin{array}{c} C \, H_{\,3} \\ \\ \\ \end{array} & \begin{array}{c} C \, H_{\,3} \\ \\ \\ \end{array} & \begin{array}{c} C \, H_{\,3} \\ \\ \\ \end{array} & \begin{array}{c} C \, H_{\,3} \\ \\ \\ \end{array} & \begin{array}{c} C \, H_{\,3} \\ \\ \end{array} & \begin{array}{c} C \, H_{\,3} \\ \\ \\ \end{array} & \begin{array}{c} C \, H_{\,3} \\ \\ \\ \end{array} & \begin{array}{c} C \, H_{\,3} \\ \\$$

$$CH_{2}=CH-Si + O + CH_{3} +$$

$$\begin{array}{c} \text{C H 3} \\ \text{C H 2} = \text{C - C - O - (C H 2) \cdot 3 - S i} \\ \text{O} \\ \end{array} \begin{array}{c} \text{C H 3} \\ \text{S i - O} \\ \text{S i - C H 3} \\ \text{C H 3} \\ \text{C H 3} \\ \end{array}$$

【0020】また、これらモノマー成分中のSi-CH 3基のCH3基の1部をフェニル基に交換したものでもよ い。また、これ以外にも少なくとも1個のビニル基を有 し、重量平均分子量100~10000のポリシロキ サンマクロモノマーであれば使用可能である。ビニル基 が2個以上のものを使用するときは1個のものより使用 割合は少なくするほうが好ましい。

【0021】モノマー成分(c)としては、ビニル基を 30 含有するシラン化合物類の少なくとも1種を全単量体の 1. 0~30重量%使用する。使用割合が1. 0%未満 では得られるケイ素含有樹脂の硬化性が遅くなる可能性 があり、硬化後の樹脂の耐溶剤性も劣るおそれがある。 使用割合が30%を越えると保存安定性が不良となるお それがある。ビニル基含有シラン化合物は、ビニル基以 外にケイ素原子に直結し、加水分解性の官能基を1個、 2個又は3個有するものである。これらの官能基として は、特に限定しないが、炭素数1ないし4のアルコキシ ようなビニル基を含有するシラン化合物の具体例として は、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシ ラン、ビニルトリス (2-メトキシエトキシ) シラン、 ジメチルビニルメトキシシラン、メチルビニルジメトキ シシラン、メチルピニルジエトキシシラン、アーアクリ ロキシプロピルトリメトキシシラン、アーアクリロキシ プロピルメチルジメトキシシラン、ァーアクリロキシプ ロピルトリエトキシシラン、ケーメタクリロキシプロピ ルトリメトキシシラン、アーメタクリロキシプロピルメ チルジメトキシシラン、γ-メタクリロキシプロピルジ 50 (a)~(d)郡のモノマー成分を、(a)をラジカル

メチルメトキシシラン、γ-メタクリロキシプロピルト リエトキシシラン、およびァーメタクリロキシプロピル メチルジエトキシシランが挙げられる。これらのシラン 化合物およびモノマー成分(b)である末端にアルコキ シシリル基を持つポリシロキサンが、空気中の水分によ り加水分解することで活性なシラノール基となり、相互 に縮合反応することにより、樹脂の架橋が生起する。

【0022】モノマー成分(d)としてはカルボン酸基 を有する重合性モノマーの1種を全単量体の0~5重量 %使用する。使用割合が5%を越えると保存安定性が不 良となるおそれがある。このモノマー成分(d)は、こ れを成分(b) および(c) と同時に重合系に添加し、 共重合することにより、得られるケイ素含有樹脂の無機 材料に対する密着性、他樹脂との相溶性、顔料分散性の 向上を図ることができる性質を有する。また、モノマー 成分(d)を加えないで重合させたケイ素含有樹脂は、 加えて重合した樹脂より保存安定性は向上する傾向にあ 基が使用しやすく、かつ好ましい結果が得られる。この 40 る。また、このモノマー成分(d)は、モノマー成分 (a) の少なくとも一種として、エポキシ基含有(メ タ) アクリルモノマーおよび/または水酸基含有(メ タ) アクリルモノマーを使用した場合、これらの官能基 と加熱により熱架橋させることもできる。モノマー成分 (d) の具体例としては、アクリル酸、メタクリル酸、 マレイン酸およびイタコン酸を挙げることができる。な お、無水マレイン酸のような酸無水物も使用することが できる。

【0023】本発明は、以上の(a)~(c)もしくは

重合させた後に、引き続き(b)、(c)を2段階でラ ジカル共重合させるか、もしくは引き続き(b)、 (c)、(d)を2段階でラジカル重合させることを特 徴とする。重合の形式は特に限定されないが、溶剤存在 下の溶液重合が実施し易くかつ好ましい結果が得られ る。すなわち、攪拌装置、還流冷却器、温度計を備えた 反応容器に、反応溶剤を仕込んでおき、50~150℃ の温度で、(a)成分およびラジカル発生剤を混合した ものをモノマー滴下槽から反応容器に徐々に滴下して反 応させた後、引き続き(b)成分、(c)成分およびラ 10 れども、耐汚染性の面で好ましくない。これに対して、 ジカル発生剤を混合したものを滴下するか、該(b), (c)成分、ラジカル発生剤および(d)成分を混合し たものを滴下し反応させるのが好ましい。ラジカル発生 剤としては、ベンゾイルパーオキサイド、t-ブチルパ ーオキシオクトエート、t ープチルパーオキシベンゾエ ート等の有機過酸化物やアゾビスイソブチロニトリル、 アゾビスメチルパレロニトリル等のアゾ化合物が好適に

使用できる。

【0024】反応溶剤としては、得られる共重合体が溶 ルエン、キシレン、n-ヘキサン、シクロヘキサンな ど)、アルコール類(メタノール、イソプロパノール、 nープタノールなど)、酢酸エステル類(酢酸エチル、 酢酸プチルなど)、エーテル類(エチルセロソルブ、ブ チルセロソルブ、セロソルプアセテート、プロピレング リコールメチルエーテル、プロピレングリコールメチル エーテルアセテートなど)、ケトン類(アセトン、メチ ルエチルケトン、アセト酢酸エチル、アセチルアセト ン、メチルイソプチルケトン、ジアセトンアルコールな み合わせて使用することもできる。反応時間(フィード 時間)は、2段階で共重合する場合、通常第1段目のモ ノマーフィード量を第2段目のモノマーフィード量より 多くする場合が多いので、第一段目の方が第2段目より 長いのが一般的である。第1段目の反応時間は1~10 時間が好ましく、より好ましくは2~6時間である。こ れにたいし、第2段目の反応時間は、1~5時間が好ま しく、より好ましくは1~3時間である。更に、全モノ マー・フィード終了後、必要に応じてラジカル発生剤を は、特に限定はされないが、常圧で反応を行うのが有利

【0025】本発明において、第一段目で成分(a)を 重合した後に、引き続き成分(b)、(c)もしくは引 き続き成分(b)、(c)および(d)を2段階で共重 合することにより、得られるケイ素含有樹脂の耐汚染性 の長期持続性および保存安定性を向上させることができ る。2段階重合の代わりに、モノマー成分(a)、

(b)、(c) もしくはモノマー成分(a)、(b)、

(c)、(d)を混合し、1段階でランダム共重合させ 50 となく、長期に渡る耐汚染性の維持および保存安定性に

た場合、耐汚染性の長期持続性および保存安定性は大幅 に劣ることになる。モノマー成分(a)のみと、モノマ 一成分(b)、(c)もしくはモノマー成分(b)、 (c)、(d)をそれぞれ別個に重合した後に、2者を プレンドしても相溶性が悪く、白濁してしまうことも多 く、好ましい結果は得られない。モノマー成分(a)、 (b) を混合し重合した後に、引き続きモノマー成分 (c) もしくはモノマー成分(c)、(d)を2段階で 共重合したケイ素含有樹脂は、保存安定性は向上するけ モノマー成分(a)、(c)を混合し、重合した後に、 引き続きモノマー成分(b)、または引き続きモノマー 成分(b)、(d)を2段階で共重合したケイ素含有樹 脂は、耐汚染性の持続性は向上するけれども、保存安定 性の面で好ましくない。モノマー成分(a)、(c)お よび(d)とを混合して共重合すると、分子量の大きな 高重合物が多く生成し、粘度が上昇するのみならず保存 安定性も低下し、好ましい結果が得られない。このよう に、モノマー成分(a)~(d)を本発明の2段階共重 解しうる溶剤であれば特に制限はなく、炭化水素類(ト 20 合以外の方法で重合しても、ケイ素含有樹脂の長所を損 なうことなく、長期に渡る耐汚染性の維持および保存安 定性に優れたケイ素含有樹脂を得ることはできない。

14

【0026】本発明のケイ素含有樹脂の重合度は、重量 平均分子量で5000~30000とすることが望ま しい。重合度は、ラジカル発生剤の種類および使用量、 重合温度および連鎖移動剤の使用によって調節すること ができる。連鎖移動剤としては、n-ドデシルメルカプ タン、t-ドデシルメルカプタンおよびγ-メルカプト プロピルトリメトキシシラン等が好適に使用できる。重 ど) が挙げられる。また、これら溶剤を2種類以上を組 30 量平均分子量が5000未満では、未重合のモノマーが 残存し易く、また、該重合体の粘度が低すぎて塗料とし た場合に作業性が良好とはいえない場合が多い。一方、 重量平均分子量が30000を越える場合には逆に粘 度が高すぎるために、作業性が不良となる場合が多い。 また、塗装後の塗膜の耐熱水性が低下する傾向が生じ

【0027】以上のようにして、本発明に係わるケイ素 含有樹脂が得られる。本発明のケイ素含有樹脂は、常温 から300℃の任意の温度で硬化させることができるた 追加補充し、数時間加熱を続けてもよい。反応時の圧力 40 め、無機材料に限らず低温硬化が望まれる木工用、プラ スチック用等の塗料用のベース樹脂にも利用できる。本 発明は成分(a)のラジカル重合後、引き続き成分 (b)、(c)、もしくは引き続き成分(b)、 (c)、(d)を重合せしめる2段階共重合方式を採用 することにより、前述した1段階重合の場合、または成 分(a)と(b)もしくは(a)と(c)を混合し1段 目として共重合した場合に生じる耐汚染性の持続性や保 存安定性の欠如の問題、別個重合後のプレンドの場合の 相溶性の欠如や白濁の問題等の不都合な問題を生ずるこ

優れたケイ素含有樹脂を得ることができる。また、モノ マー成分(d)を加えた場合に生じ易い高重合物の生 成、粘度の上昇および保存安定性の低下も防止できるの である。

【0028】以下、本発明を実施例により具体的かつ詳 細に説明するが、本発明は実施例により限定されるもの ではない。なお、実施例中の部はいずれも重量部を表す ものである。

[0029]

【実施例】

合成例1

СНэ

16 *攪拌装置、還流冷却器、温度計、窒素ガス導入管を取付

【0031】 ァーメタクリロキシプロピルトリメトキシ シラン15部、アクリル酸1部およびベンゾイルパーオ 下し、同温度で3時間反応を続け、重量平均分子量60 000の重合体Aを得た。

【0032】合成例2

アクリル酸(モノマー成分(d)) を使用しない以外 は、合成例1と同様に重合し、重量平均分子量6000 0の重合体Bを得た。

【0033】合成例3

攪拌装置、還流冷却器、温度計、窒素ガス導入管を取付※

※けたフラスコに、キシレン100部、n-ブタノール5 0部を仕込み100℃に加熱した。窒素雰囲気下、フラ キサイド 0.2部の混合液を同条件下で1時間かけて滴 20 スコ内を攪拌しながら、メタクリル酸メチル34部、メ タクリル酸グリシジル15部、アクリル酸n-ブチル2 0部、スチレン10部およびベンゾイルパーオキサイド 0. 3部の混合液を3時間かけて滴下した。さらに引き 続き下記に示すビニル基含有ポリシロキサンマクロモノ マー5部(重量平均分子量:6000)、

[0034] 【化16】

$$\begin{array}{c} C H_{3} \\ | \\ C H_{2} = C - C - O - (C H_{2})_{3} \\ | \\ O \end{array} \begin{array}{c} C H_{3} \\ | \\ | \\ S i - O \\ | \\ C H_{3} \end{array} \begin{array}{c} C H_{3} \\ | \\ C H_{2} \\ | \\ C H_{3} \end{array} \begin{array}{c} C H_{3} \\ | \\ | \\ C H_{3} \\ | \\ C H_{3} \end{array} \begin{array}{c} C H_{3} \\ | \\ | \\ C H_{3} \\ | \\ C H_{3} \end{array} \begin{array}{c} C H_{3} \\ | \\ | \\ | \\ C H_{3} \\ | \\ C H_{3} \end{array}$$

[0035] γ-メタクリロキシプロピルメチルジメト キシシラン15部、アクリル酸1部およびベンゾイルパ ーオキサイド 0. 2 部の混合液を同条件下で 1 時間かけ て満下し、同温度で3時間反応を続け、重量平均分子量 70000の重合体Cを得た。

【0036】合成例4

攪拌装置、還流冷却器、温度計、窒素ガス導入管を取付 けたフラスコに、キシレン100部、n-ブタノール5 0部を仕込み100℃に加熱した。窒素雰囲気下、フラ★

★スコ内を攪拌しながら、メタクリル酸メチル34部、メ タクリル酸2-ヒドロキシエチル15部、アクリル酸n -ブチル20部、スチレン10部およびベンゾイルパー オキサイド 0. 3部の混合液を 3時間かけて滴下した。 さらに、引き続き下記に示すビニル基含有ポリシロキサ 40 ンマクロモノマー5部 (重量平均分子量:5500)、

[0037]

【化17】

$$\begin{array}{c} C H_{3} \\ | \\ C H_{2} = C - C - O - (C H_{2})_{3} - S i \\ | \\ O \end{array} \begin{pmatrix} C H_{3} \\ | \\ S i - O \\ | \\ C H_{3} \\ | \\ C H_{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C H_{3} \\ | \\ | \\ C H_{3} \\ | \\ C H_{3} \end{pmatrix}$$

【0038】 ァーメタクリロキシプロピルトリメトキシ 50 シラン15部、アクリル酸1部およびベンゾイルパーオ

キサイド 0. 2 部の混合液を同条件下で 1 時間かけて滴 下し、同温度で3時間反応を続け、重量平均分子量65 000の重合体Dを得た。

【0039】合成例5

攪拌装置、還流冷却器、温度計、窒素ガス導入管を取付 けたフラスコに、キシレン100部、n-プタノール5 0部を仕込み100℃に加熱した。窒素雰囲気下、フラ*

$$CH_{2} = C - C - O - (CH_{2})_{3} = \begin{cases} CH_{3} \\ | \\ | \\ | \\ CH_{3} \end{cases} = CH_{3}$$

$$CH_{3} = CH_{3}$$

【0041】 ァーメタクリロキシプロピルメチルジメト キシシラン15部、アクリル酸1部およびベンゾイルパ ーオキサイド 0. 5 部の混合液を 4 時間かけて滴下し、 その後同温度で3時間反応を続け、重量平均分子量90 000の重合体Eを得た。

【0042】合成例6

機律装置、還流冷却器、温度計、窒素ガス導入管を取付 20 【0043】 けたフラスコに、キシレン100部、n-プタノール5※

$$\begin{array}{c} C H_3 \\ C H_2 = C - C - O - (C H_2)_3 & \begin{pmatrix} C H_3 \\ | \\ | \\ C H_3 \end{pmatrix} & C H_3 \\ | C H_3 \end{pmatrix}_{n} C H_3 \\ | C H_3 \end{pmatrix}$$

[0044] およびベンゾイルパーオキサイド0.3部 の混合液を3時間かけて滴下した。さらに、引き続き γ アクリル酸1部およびベンゾイルパーオキサイド0.2 部の混合液を同条件下で1時間かけて滴下し、同温度で 3時間反応を続け、重量平均分子量6000の重合体 Fを得た。

【0045】合成例7

攪拌装置、還流冷却器、温度計、窒素ガス導入管を取付 けたフラスコに、キシレン100部、n-プタノール5★

$$\begin{array}{c} C H_3 \\ | \\ C H_2 = C - C - O - \langle C H_2 \rangle_3 & \begin{pmatrix} C H_3 \\ | \\ S i - O \\ | \\ C H_3 \end{pmatrix} & C H_3 \\ | \\ C H_3 \end{pmatrix}_{D} C H_3 \end{array}$$

【0047】アクリル酸1部およびペンゾイルパーオキ サイド 0. 2 部の混合液を同条件下で 1 時間かけて滴下 し、同温度で3時間反応を続け、重量平均分子量800 00の重合体Gを得た。

【0048】合成例8

イ) 攪拌装置、還流冷却器、温度計、窒素ガス導入管 を取付けたフラスコに、キシレン100部、n-プタノ 50 0の重合体を得た。

*スコ内を攪拌しながら、メタクリル酸メチル34部、メ タクリル酸グリシジル15部、アクリル酸n-プチル2 0部、スチレン10部、下記に示すビニル基含有ポリシ ロキサンマクロモノマー5部(重量平均分子量:550 0)、

18

[0040] 【化18】

タクリル酸グリシジル15部、アクリル酸n-ブチル2 0部、スチレン10部、下記に示すビニル基含有ポリシ ロキサンマクロモノマー5部(重量平均分子量:550 0), 【化19】

※0部を仕込み100℃に加熱した。窒素雰囲気下、フラ

スコ内を攪拌しながら、メタクリル酸メチル34部、メ

★0部を仕込み100℃に加熱した。窒素雰囲気下、フラ スコ内を攪拌しながら、メタクリル酸メチル34部、メ ーメタクリロキシプロピルトリメトキシシラン15部、 30 タクリル酸グリシジル15部、アクリル酸n-ブチル2 0部、スチレン10部、アーメタクリロキシプロピルト リメトキシシラン15部、およびペンゾイルパーオキサ イド0.3部の混合液を3時間かけて滴下した。さら に、引き続き下記に示すビニル基含有ポリシロキサンマ クロモノマー5部(重量平均分子量:5500)、

[0046]

ール50部を仕込み100℃に加熱した。窒素雰囲気 下、フラスコ内を撹拌しながら、メタクリル酸メチル3 4部、メタクリル酸グリシジル15部、アクリル酸n-プチル20部、スチレン10部およびペンゾイルパーオ キサイド 0. 3 部の混合液を 3 時間かけて滴下し、その 後同温度で3時間反応を続け、重量平均分子量5500

を取付けたフラスコに、キシレン100部、n-プタノ -ル50部を仕込み100℃に加熱した。窒素雰囲気 下、フラスコ内を攪拌しながら、下記に示すピニル基含*

シラン70部、アクリル酸5部およびペンゾイルパーオ キサイド2. 0部の混合液を1時間かけて滴下し、その 後同温度で3時間反応を続け、重量平均分子量1200 00の重合体を得た。その後イ)の重合で得られた重合 体80部とロ)の重合で得られた重合体20部をプレン ドし、重合体Hを得た。

【0051】実施例1~4

合成例1~4で得られた重合体A, B, CおよびDをそ れぞれ等重量のキシレンで希釈し、希釈液をステンレス 20 〇 まったく変化無し 板 (SUS430BA) 上に乾燥膜厚10μmになるよ うに塗装し、180℃で30分焼き付けた。次いで、得 られた試験板を用いて下記に示す各試験項目について性 能試験を行った。その結果を表1に示す。

比較例4~7

合成例4~7で得られた重合体E, F, GおよびHを用 い、実施例と同様の方法で試験板を作成した。次いで、 得られた試験板を用いて実施例と同様の試験を行った。 その結果を表1に示す。

【0052】試験項目および試験法

試験板の外観を目視にて判定した。

- 無色透明
- × 白獨不均一

鉛筆硬度

20 ロ) 攪拌装置、還流冷却器、温度計、窒素ガス導入管 *有ポリシロキサンマクロモノマー25部(重量平均分子 量:5500)、

[0049]

【化21】

$$\begin{array}{c}
\begin{pmatrix}
C H_3 \\
\downarrow \\
S i - O
\end{pmatrix} & \begin{array}{c}
C H_3 \\
\downarrow \\
S i - C H_3
\end{array}$$

JIS K 5400に準拠して行った。

付着性

試験板を用い基板目剥離テスト(1mm幅にカッターナ イフで100個のマス目を塗膜に作り、得られる基板目 に対してセロハンテープで3回剥離操作を繰り返す。) を行い剥離せずに付着している数を示した。

耐熱水性

試験板を蓋付き沸騰水容器で沸騰水に5時間浸漬後判定 した。

× 白化等の変化あり

耐汚染性(初期)

試験板に油性のマジックインキでマーキングし、1時間 放置後トルエンを用いて拭き取り判定した。

- まったく跡がつかない
- △ わずかながら跡が残る
- × 明らかに跡が残る

耐汚染性(暴露後)

6ヶ月間屋外暴露(横浜市)した試験板を用い、上記の 30 耐汚染性(初期)と同様の試験を行った。

安定性

50ccサンプル瓶に重合体A~Gをそれぞれ40cc 取り、50℃で放置しゲル化に要する時間を観察した。 [0053]

【表1】

表 1

		実 が	色例		比 較 例			
	1	2	8	4	Б	6	7	8
重合体	A	В	С	D	E	F	G	н
外観	0	0	0	0	0	0	0	×
鉛筆便度	2H	2H	3 H	2H	2H	2H	2 H	н
付着性	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	80/100
耐熱水性	0	0	0	0	0	0	0	×
耐汚染性(初期)	0	0	0	0	0	0	0	Δ
耐汚染性(暴露後)	0	0	0	0	×	×	0	×
安定性	>10日	>10日	>10日	>10日	<5日	>10日	<5日	<3目

【0054】表1から明らかなように、本発明により得 られたケイ素含有樹脂は、耐汚染性の持続性および保存 安定性の双方に優れていることが判る。

[0055]

【発明の効果】以上のように、本発明はモノマー成分 (a) をラジカル重合した後に、引き続きモノマー成分

階でラジカル共重合することにより、ケイ素含有樹脂の 長所を損なうことなく、耐汚染性の長期にわたる持続性 および保存安定性の双方に優れたケイ素含有樹脂を製造 することができる。本発明の方法に従って得られるケイ 素含有樹脂は、耐汚染性および保存安定性が良好なこと (b)、(c)、もしくは引き続きモノマー成分 30 から、**塗料**用のベース樹脂として有用である。

(b)、(c)、(d)の混合物を重合系に添加し2段